



化合物三羟基氯三硼酸铯和三羟基氯三硼酸铯双折射晶体及制备方法和用途

潘世烈¹; 焦佳豪; 张敏¹

2022-08-30

专利权人

中国科学院新疆理化技术研究所

专利类型

发明专利

摘要

本发明涉及一种化合物三羟基氯三硼酸铯和三羟基氯三硼酸铯双折射晶体及制备方法和应用, 该化合物的分子式为CsB₃O₃(OH)₃Cl, 分子量为299.81, 采用温和的溶剂蒸发法制成。该晶体化学式为CsB₃O₃(OH)₃Cl, 分子量为299.81, 属于单斜晶系, 空间群是P2₁/c, 晶胞参数a=8.175(3) Å, b=7.927(2) Å, c=14.096(4) Å, β=120.219(17)°, V=789.3(4) Å³, Z=4, 采用室温溶液法或水热法生长晶体, 该晶体紫外透过截止边为180 nm, 双折射率约为0.109 (532 nm)。本发明所述的三羟基氯三硼酸铯双折射晶体机械硬度适中, 易于生长、切割、抛光加工和保存; 具有较大的双折射率; 在光学和通讯领域有重要应用, 可用于制作偏振分束棱镜, 相位延迟器件和电光调制器件等。

申请日期

2022-04-29

申请号

CN202210473394.7

公开(公告)号

114956110A

代理机构

乌鲁木齐中科新兴专利事务所(普通合伙) 65106

文献类型

专利

条目标识符

http://ir.tianshanzw.cn/handle/365002/8574

专题

材料物理与化学研究室

推荐引用方式

潘世烈,焦佳豪,张敏. 化合物三羟基氯三硼酸铯和三羟基氯三硼酸铯双折射晶体及制备方法和用途. 114956110A[P]. 2022-08-30. GB/T 7714

条目包含的文件

条目无相关文件。

所有评论 (0)

[发表评论/异议/意见]

暂无评论

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

个性服务

推荐该条目

★ 保存到收藏夹

📊 查看访问统计

📄 导出为Endnote文件

谷歌学术

📖 谷歌学术中相似的文章

📖 [潘世烈]的文章

📖 [焦佳豪]的文章

📖 [张敏]的文章

百度学术

📖 百度学术中相似的文章

📖 [潘世烈]的文章

📖 [焦佳豪]的文章

📖 [张敏]的文章

必应学术

📖 必应学术中相似的文章

📖 [潘世烈]的文章

📖 [焦佳豪]的文章

📖 [张敏]的文章

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享

